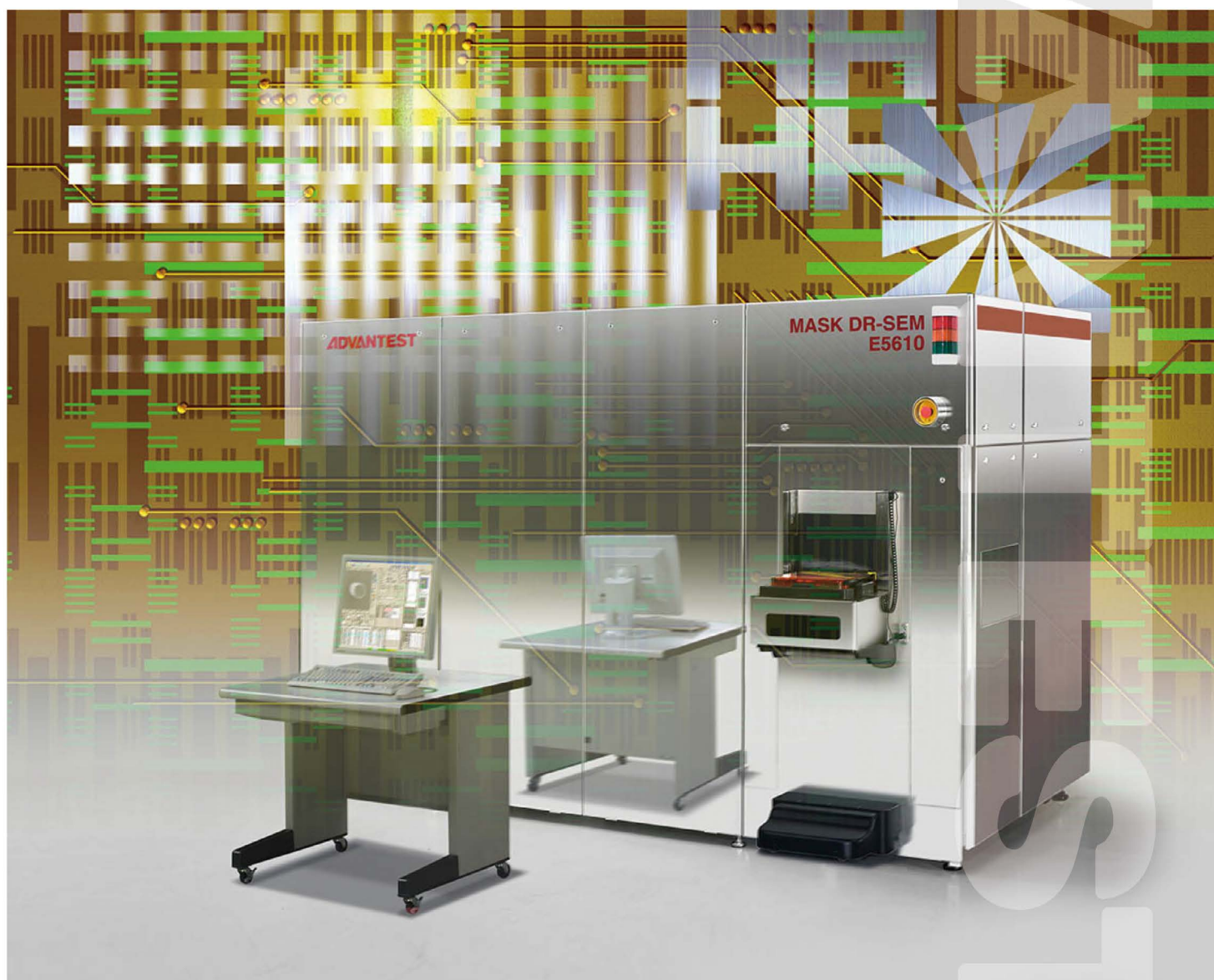


ADVANTEST[®]

MASK DR-SEM

E5610

フォトマスク対応の欠陥レビューSEM



E5610は、フォトマスク上の微小欠陥のレビューとクラシフィケーションを可能にする、MASK DR-SEM¹⁾です。

当社独自の高いチャージ抑制技術とステージ精度により、高安定・全自動画像取得が可能となり、欠陥検査装置より出力される座標データから簡単に欠陥をイメージングする事ができます。

さらにオプションで、EDS²⁾による元素分析機能も搭載可能です。

E5610は、高精度、高スループットの欠陥レビュー性能により、最先端フォトマスクの品質向上とTAT短縮に貢献します。

1) Defect Review - Scanning Electron Microscope(欠陥レビュー用走査型電子顕微鏡)

2) Energy Dispersive X-ray Spectrometry(エネルギー分散型X線分析)

高い空間分解能

当社独自のカラム・アーキテクチャにより、フォトマスクの観察に適した低加速電圧でも、2nmという高い空間分解能を実現しました。

高安定・全自動画像取得

高精度ステージ、チャージアップ抑制技術、コンタミネーション低減技術により、高いSEM倍率においても自動、かつ安定的に欠陥画像を高スループットで取得できます。

欠陥検査装置との連携

欠陥検査装置から出力される欠陥位置情報を読み込み、該当位置の欠陥画像を自動収集します。

元素分析機能

最新のEDSモジュールが搭載可能です。観察部位から放出される特性X線のスペクトラムを分析し、構成元素を特定します。

MVM-SEMIは、(株)アドバンテストの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。



一般仕様

搬送可能試料： 6025サイズのフォトマスク

SEM空間分解能： 2nm

ステージ位置決め精度： ±75nm

加速電圧： 0.3kV~10kV

プローブ電流： 1pA~1nA

EDSエネルギー分解能*： 138eV

*オプション

※EDSモジュールについては別途ご相談下さい。

- 本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 本カタログ記載の製品仕様及び外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

ADVANTEST®

<https://www.advantest.com/>

株式会社アドバンテスト

●お問い合わせは
ナノテクノロジー事業本部
〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-5 埼玉R&Dセンタ
TEL : 0480-72-6300
E-mail : PDL-AT-info_nano@advantest.com